

СТРУКТУРА ПИКОВ E_4 И E_5 В n -GaAs

Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М.

В облученном при комнатной температуре гамма-квантами и электронами n -GaAs впервые наблюдались радиационные центры P_2 и P_3 до проведения высокотемпературного отжига. Показано, что при энергии электронов более 1 МэВ основной вклад в спектр НЕСГУ в интервале температур выше 250 К вносят центры E_4 и P_3 , причем с увеличением энергии электронов их доля в суммарном спектре растет. Кроме того, скорости введения центров E_4 , P_3 и, возможно, P_2 зависят от температуры облучения. Это свойство, а также более эффективный рост скоростей введения центров P_2 , P_3 и E_4 по сравнению с E_5 при увеличении энергии облучающих частиц указывают на то, что эти центры являются комплексными.

Для энергии активации термоэмиссии электронов с радиационного центра E_4 в n -GaAs получены значения от 0.64 до 0.76 эВ, а для радиационного центра E_5 — от 0.83 до 0.96 эВ [1-3]. Все измерения проводились методом нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней (НЕСГУ), поэтому различие в полученных результатах слишком велико, чтобы связать его с погрешностью измерений. Результаты, представленные в работах [1-4], позволяют предположить, что форма участка спектра, содержащего пики E_4 и E_5 , и полученные значения энергии активации эмиссии электронов со соответствующими центрами зависят от условий облучения (температуры образца и энергии облучающих частиц). Возможно, на форму спектра влияют и радиационные центры P_2 и P_3 , которые наблюдались после высокотемпературного облучения или отжига [5, 6] (при облучении электронами 1 МэВ их скорость введения на порядок меньше, чем скорость центров E_4 и E_5 [1]). Однако непосредственно после облучения при 300 К их обнаружить не удалось, поэтому нет уверенности в том, что центры P_2 и P_3 формируются при комнатной или более низких температурах.

Учитывая то, что дефекты, вносящие близкие к середине запрещенной зоны уровни, могут быть эффективными центрами рекомбинации и оказывать существенное влияние на функционирование некоторых полупроводниковых приборов, целью данной работы мы поставили изучение структуры спектра НЕСГУ в интервале температур выше 250 К и определение параметров, характеризующих эмиссию электронов со соответствующими центрами.

При исследовании облученного электронами 7 и 25 МэВ эпитаксиального n -GaAs с концентрацией носителей $2 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ (использовались барьеры Шоттки) было замечено, что длительность импульсов заполнения существенно влияет на форму спектра НЕСГУ в интервале температур выше 250 К (рис. 1). Установлено, что увеличение длительности импульсов заполнения приводит к изменению спектрального распределения в области пика E_5 . Зависимость формы участка спектра от длительности импульсов заполнения указывает на то, что захват электронов по крайней мере частью центров, вносящих вклад в рассматриваемый участок спектра, ограничен энергетическим барьером. В GaAs ранее обнаружены радиационные дефекты, обладающие подобным свойством [7]. Чтобы определить, какие центры влияют на такое изменение формы спектра, анализировались кривые, представляющие собой разность двух спектров НЕСГУ, полученных при разных длительностях импульсов заполнения и одинаковом окне скорости эмиссии. Вклад в такие разностные спектры будут

вносить лишь те центры, постоянная времени заполнения которых соизмерима с интервалом времени между выбранными длительностями импульсов заполнения.

На рис. 1 показаны спектры НЕСГУ в интервале температур от 230 до 330 К, записанные при двух разных длительностях импульсов заполнения,

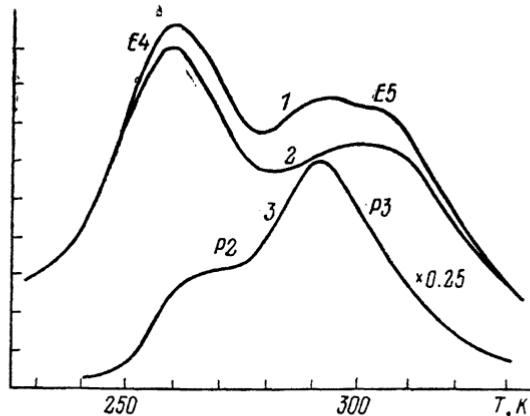


Рис. 1. Спектры НЕСГУ радиационных дефектов в арсениде галлия, облученном электронами 7 МэВ.

Окно скорости эмиссии $e_n = 0.55 \text{ с}^{-1}$. Длительность импульсов заполнения: 1 — 1 мс, 2 — 30 мкс; 3 — разностный спектр, полученный при длительностях импульсов заполнения 30 мкс и 1 мс.

а также разностный спектр, полученный при тех же значениях длительностей этих импульсов. Видно, что изменение формы спектра НЕСГУ происходит из-за заполнения центров, пики эмиссии которых изображены на разностном спектре. Для идентификации этих центров было дополнительно изучено их поведение в процессе термического отжига, в результате которого установлено, что в интервале температур до 630 К оно аналогично поведению центров P_2 и P_3 [8].

Кроме того, на рис. 2 представлены графики Аррениуса для центров, вносящих пики в разностный спектр, а также для центров P_2 и P_3 , наблюдавшихся в спектре НЕСГУ после высокотемпературного отжига, в процессе которого удаляются центры E_4 и E_5 . Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что пики на разностном спектре обусловлены центрами

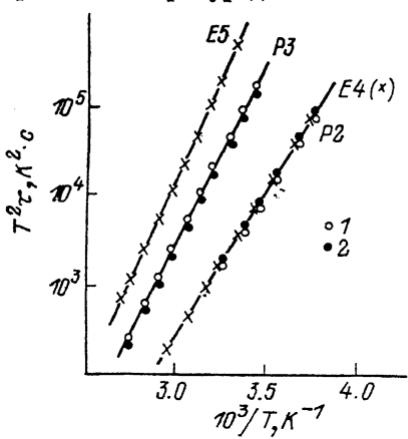


Рис. 2. Графики Аррениуса для центров E_4 , E_5 , P_2 и P_3 .

1 — до термического отжига, 2 — после отжига.

P_2 и P_3 . Наблюдение в спектре этих пиков до проведения высокотемпературного отжига подтверждает предположение авторов [1, 2] о том, что центры P_2 и P_3 могут вводиться непосредственно в процессе облучения при 300 К.

При применении метода НЕСГУ для исследования электрически активных центров в полупроводниковых структурах полагается, что процессы захвата и эмиссии электронов характеризуются двумя параметрами — энергией активации и некоторым феноменологическим коэффициентом, одинаковым для обоих процессов, называемым сечением захвата σ_{ni} . Однако в арсениде галлия обнаружены радиационные центры, скорость заполнения которых не соответствует значениям, рассчитанным по результатам НЕСГУ, контролирующим процесс эмиссии носителей заряда [7]. Например, установлено, что энергия активации

эмиссии электронов с центра $E10$ равна 0.34 эВ, сечение захвата $\sigma_{ne} = 3 \cdot 10^{-44}$ см 2 . В исследуемом материале центры с такими величинами сечений захвата должны заполняться электронами быстрее, чем за 10 нс. Заполнение же центра $E10$ в течение сотен микросекунд указывает на то, что определяемая методом НЕСГУ величина упомянутого коэффициента не равна сечению захвата электронов на центр. Учитывая размерность (в см 2), будем называть эту величину сечением эмиссии σ_{ne} по аналогии с параметром, характеризующим процесс захвата. Неравенство сечений эмиссии и захвата характерно для метастабильных центров, которые в процессе заполнения могут менять свою конфигурацию. Аналогичный эффект наблюдался также в облученном арсениде галлия для A -конфигурации бистабильного центра $E1$, заполнение которого ограничено энергетическим барьером, разделяющим две конфигурации [7], и для подобных центров в других полупроводниках.

Анализ полученных результатов показал, что энергия активации эмиссии электронов с центра $P3$, полученная на исследуемых образцах, равна 0.79 эВ, сечение эмиссии электронов $\sigma_{ne} = 3 \times 10^{-12}$ см 2 , а скорости термоэмиссии электронов с центров $E4$ и $P2$ имеют близкие температурные зависимости, которые характеризуются энергией активации 0.63 эВ и сечением эмиссии $6 \cdot 10^{-14}$ см 2 (рис. 2), причем центр $E4$ полностью заполняется при длительности импульсов менее 10 мкс.

Сравнение амплитуд пиков $P2$, $P3$ на спектрах НЕСГУ и на разностных

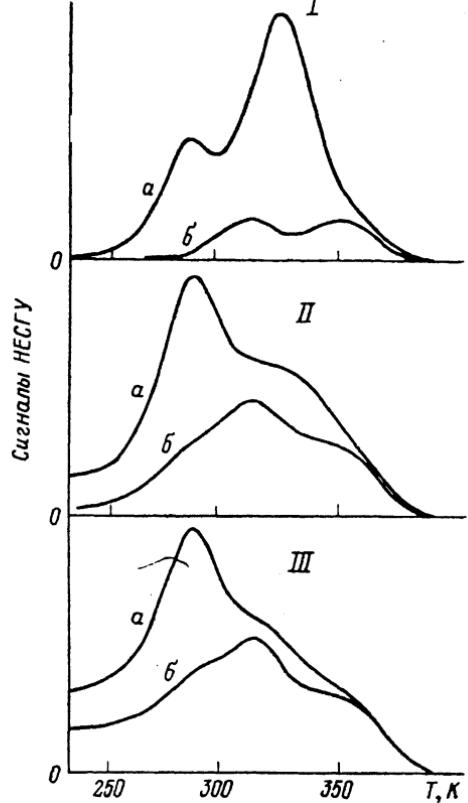


Рис. 3. Спектры НЕСГУ радиационных дефектов в арсениде галлия, образованных при облучении гамма-квантами ^{60}Co (I) и электронами 7 (II) и 25 МэВ (III), записанные до (a) и после (b) термического отжига (220 °C).

Окно скорости эмиссии $e_n = 10.8$ с $^{-1}$.

спектрах, записанных после отжига облученных образцов при 600 К, показало, что в интервале длительностей импульсов заполнения от 30 мкс до 1 мс дозаполняется лишь часть центров $P2$ и $P3$ (~20 %), а в основном заполнение происходит при меньших длительностях импульсов. Поэтому определить их концентрацию можно лишь обычным методом НЕСГУ после отжига маскирующих центров $E4$ и $E5$. На рис. 3 показаны спектры НЕСГУ, полученные на облученных структурах до и после проведения термического отжига, из которых видна сильная зависимость соотношения амплитуд рассматриваемых пиков и, следовательно, скоростей введения соответствующих центров от энергии облучающих частиц. Для центров $E4$, $E5$, $P2$ и $P3$ при облучении электронами 7 МэВ скорости введения соотносятся как 2.5 : 1 : 1.3 : 1.7, а 25 МэВ — как 5 : 1 : 2.5 : 3.5 (для всех видов облучения нормировка заполнена по концентрации центра $E5$), т. е. при высокой энергии облучающих частиц основной вклад в спектр в области регистрации пика $E5$ вносит центр $P3$, а не $E5$, как считалось ранее. При облучении гамма-квантами для скоростей введения центров $E4$, $E5$ и $P3$ получено соотношение 0.5 : 1 : 0.18. Пик $P2$ после гамма-облучения в спектре не обнаружен (возможно, он и вводится, но его концентрация мала, пик маскируется более интенсивным соседним пиком $P3$). Низкотемпературное облучение гамма-квантами показало, что скорость введения центра $P3$ зависит от температуры облучения. В структурах, облученных при 78 К, центр $P3$

отсутствует и не образуется в процессе последующих высокотемпературных (до 600 К) отжигов (рис. 3). Напомним, что скорости введения центров $E4$ и $E10$ также зависят от температуры облучения [4-7]. Описанные свойства центров $P2$ и $P3$ позволяют предположить, что они, так же как и центр $E4$, представляют собой комплексы, в состав которых входят первичные нарушения кристаллической решетки. Нельзя исключать и возможность взаимодействия собственных структурных нарушений с примесными атомами.

Присутствие в облученном материале центра $P3$ усложняет получение точной информации о параметрах центра $E5$ и, возможно, является основной причиной того, что приведенные в литературе значения энергий активации и сечений эмиссии электронов с центра $E5$ значительно различаются [1-3]. Очевидно, наиболее точные значения параметров центра $E5$ могут быть получены в случае, если влияние центров $E4$ и $P3$ минимально, т. е. на образцах, облученных гамма-квантами при низких температурах [4]. После такого облучения при 78 К для центра $E5$ получены значения энергии активации термоэмиссии 0.88 эВ и сечение эмиссии электронов $6.7 \cdot 10^{-12} \text{ см}^2$.

Параметры термоэмиссии электронов с центров $E5$ и $P3$ указывают на то, что они могут являться центрами рекомбинации. Однако наличие энергетического барьера, уменьшающего вероятность захвата электронов, позволяет предположить, что центр $P3$ в отличие от центра $E5$ не может эффективно участвовать в процессах рекомбинации носителей заряда.

Таким образом, детальное изучение спектров НЕСГУ показало, что в интервале температур эмиссии электронов с центров $E4$ и $E5$ в спектр вносят существенный вклад и центры $P2$ и $P3$, образующиеся в процессе облучения при температуре 300 К. При этом если энергия электронов более 1 МэВ, то основной вклад дают центры $E4$ и $P3$, с увеличением энергии электронов их доля в суммарном спектре растет. Более того, скорости введения центров $E4$, $P3$ и, возможно, $P2$ зависят от температуры облучения. Это свойство, а также более эффективный рост скоростей введения центров $P2$, $P3$ и $E4$ по сравнению с $E5$ при увеличении энергии облучающих частиц указывают на то, что они представляют собой комплексы и являются причиной зависимости формы рассматриваемого участка спектра НЕСГУ от условий облучения.

Полученные новые экспериментальные результаты подтверждают сделанный ранее вывод о сложности процесса образования радиационных дефектов в n -GaAs [4, 7].

Список литературы

- [1] Pons D., Bourgoin J. // J. Phys. C: Sol. St. Phys. 1985. V. 18. N 20. P. 3839-3871.
- [2] Pons D., Moonay P., Bourgoin J. // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. N 4. P. 2038-2042.
- [3] Ланг Д. // Точечные дефекты в твердых телах. М., 1979. С. 187-220.
- [4] Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 1. С. 185-187.
- [5] Pons D., Mircea A., Bourgoin J. // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. N 8. P. 4150-4157.
- [6] Brudniy V. N., Peschev V. V. // Phys. St. Sol. (a). 1988. V. 105. N 1. P. K57-K60.
- [7] Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 9. С. 1635-1639.

Научно-исследовательский институт
прикладных физических проблем
при БГУ им. В. И. Ленина
Минск

Получена 20.02.1990
Принята к печати 11.04.1990